

BERIGTIGELSER

Berigtigelse til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2199 af 17. oktober 2019 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse

(Den Europæiske Unions Tidende L 338 af 30. december 2019)

På side 129 læses punkt f således:

»f. Følgende litografiske udstyr:

1. Step and repeatudstyr (direkte waferstepper) eller step and scanudstyr (scanner) til positionering og eksponering i forbindelse med waferprocesser ved brug af foto-optiske eller røntgenmetoder og med en eller flere af følgende egenskaber:

a. Lyskildebølgelængde kortere end 193 nm eller

b. I stand til at frembringe et mønster med en »mindste detaljeopløsning' (MRF) på 45 nm eller derunder.

Teknisk note:

»Mindste detaljeopløsning« (MRF) beregnes efter følgende formel:

$$MRF = \frac{(\text{lyskildens bølglængde i nm}) \times (K\text{-faktor})}{\text{blændetal}}$$

hvor $K\text{-faktor} = 0,35$.

2. Litografisk udstyr til prægning, der kan frembringe detaljer på 45 nm eller mindre

Note: 3B001.f.2. omfatter:

— Mikrokontakttrykkeredskaber

— Varmeprægningsredskaber

— Litografiske redskaber til nanoprægning

— Litografiske (S-FIL) redskaber til step-and-flash-prægning

3. Udstyr, der er specielt konstrueret til maskefremstilling med alle følgende egenskaber:

a. En afbøjet fokuseret elektronstråle, ionstråle eller »laser«-stråle og

b. En eller flere af følgende egenskaber:

1. En fuld halvværdibredde (FWHM) pletstørrelse, der er mindre end 65 nm, og en billedplacering på mindre end 17 nm (gennemsnit + 3 sigma) eller

2. Ikke anvendt

3. Second-layer overlay error på mindre end 23 nm (gennemsnit + 3 sigma) på masken

4. Udstyr, der er konstrueret til behandling af indretninger, og som bruger direkte skrivemetoder, med alle følgende egenskaber:

a. En afbøjet fokuseret elektronstråle og

b. En eller flere af følgende egenskaber:

1. Stråle med en minimumstørrelse på højst 15 nm eller

2. Overlay error på mindre end 27 nm (gennemsnit + 3 sigma)«
